



01.06.12

Первая встреча российских пользователей оборудования Raith состоялась в Москве 28 мая 2012 года состоялась первая встреча пользователей оборудования Raith на территории России, в которой приняли участие 65 специалистов из различных уголков страны (Москва, Санкт-Петербург, Самара и Екатеринбург, Минск).

С приветственным словом к участникам семинара обратился директор Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН, д.т.н., профессор Петр Павлович Мальцев. ИСВЧПЭ имеет многолетний опыт работы с оборудованием Raith, в Лаборатории исследования процессов электронной литографии формирования сверхкороткоканальных нм- транзисторов ведутся научно-исследовательские работы с использованием электронно-лучевого литографа нового поколения Raith 150 TWO.

О компании Raith и истории партнерства и сотрудничества с российскими и международными научными центрами рассказал руководителю отдела международных продаж и маркетинга компании Raith Дирк Брюггеманн. Он отметил, что в России растущий, интересный рынок высокотехнологичного оборудования для нанотехнологий, за шесть лет работы в России было установлено более 20 систем Raith, основные потребители – академические институты, центры коллективного пользования и вузы.

Семинар продолжил руководитель отдела Материаловедения компании ОПТЭК Вячеслав Власенко, он познакомил участников со структурой и географией работы компании, комплексными решениями ОПТЭК для науки и образования, отметил, что ОПТЭК является сильным стратегическим партнером Raith на территории России и СНГ.

О полной линейке продукции и особенностях использования оборудования рассказал директор по развитию новых рынков компании Raith Мартин Кирхнер, а менеджер по продуктам компании Raith Свен Бауэрдик подробно остановился на ионно-лучевой литографии и новой концепции совмещения электронно- и ионно-лучевой литографии twinLITH. Установки eLINEplus и ionLINE удачно дополняют друг друга объединяя преимущества каждого метода в отдельности.

С докладами о достижениях и результатах работы также выступили пользователи, имеющие большой опыт работы с электронно-лучевыми литографами и приставками Raith: Федоров Юрий Владимирович (ИСВЧПЭ РАН), Гончаров Антон Сергеевич (МГТУ им. Н.Э. Баумана), Галиев Ринат Радифович (ИСВЧПЭ РАН), Ерофеев Евгений Викторович (ЗАО "НПФ "Микран") и Преснов Денис Евгеньевич (Лаборатория Криоэлектроники, МГУ им. М.В.Ломоносова).

Сотрудник научно-исследовательского подразделения Raith Леонид Литвин рассказал о 2-х методах экспонирования, работающих без стыковки полей – методе ФБМС (Fixed Beam Moving Stage) и его новой модификации МБМС (Modulated Beam Moving Stage). В процессе литографии при стандартном экспонировании со стыковкой полей линии на границе имеют излом равный ошибке стыковки, что отрицательно сказывается,

например, на мощности излучения длинных волноводов. Представленная технология позволяет избежать процесса стыковки и ошибки стыковки не возникает. ФБМС создает непрерывные линии, а с помощью МБМС можно легко создавать решетки линий, один размер которых ограничен, а второй размер может быть произвольным.

Представители компании Raith, участвовавшие в мероприятии признали это событие крупнейшим среди подобных пользовательских встреч в мире. Участники семинара выразили пожелание проводить такие встречи на регулярной основе

http://www.optec.zeiss.ru/news/Pervaia_vs.html - источник